

契約企業様向け「平成 28 年度公開進捗報告会」および 「第 2 回特許&ノウハウ解説講演会」

1. 日程 ; 平成 28 年 9 月 14 日(水) 13:15~17:00

2. 場所 ; 研究所 6F

3. スケジュール

13:15~13:20 挨拶 本間先生

13:20~14:35 公開進捗報告会・前半(15分/名) 田代

1. 新規無電解めっきによるガラスへのパターン形成 : D3 岡部陸平

2. ウェットプロセスによるウエハー上への再配線形成 : D3 押切絢貴

3. ポリイミドフィルム上への無電解めっきによる高密着ファインパターン形成 : M2 鈴木陽平

4. 硫黄化合物による水素化ホウ素化合物のアノード酸化の抑制 : D3 水橋正英

5. 樹脂上に形成された配線の導体および絶縁体の界面状態が高速伝送特性に与える影響 : D1 石井智之

14:35~14:45 休憩(および時間調整)

14:45~16:00 公開進捗報告会・後半(15分/名)

6. UV処理を用いたABS樹脂へのめっき : D1 中林右希

7. UBMS法によるCNx皮膜の作製と閥膜環境下における揮発特性 : D2 上山秀明

8. 微細構造をもつ材料表面の微小水滴に対する走査電子顕微鏡を用いた評価 : D1 井上雅行

9. アクティブスクリーンを併用させた直流プラズマ浸炭によるS相の形成 : D3 里見宣彦

10. 表面改質ポリマー上の選択的無電解めっき : D3 堀内義夫

16:00~16:10 休憩(および時間調整)

16:10~17:00 第2回特許&ノウハウ解説講演会 渡辺先生

以上